



PW 3000

Plasmaschweißverfahren mit übertragenem Lichtbogen für
automatisierte und manuelle Anwendung



Dieses Gerät ist geeignet für Schweißaufgaben, die Präzision, hohe Qualität und geringe Aufmischung erfordern. PW 3000 liefert 20 – 300 A Schweißstrom. Das ist für alle Pulverschweißaufgaben ausreichend. Bei diesem Verfahren wird durch die Einschnürung eines Lichtbogens mittels einer gasgekühlten Anode ein Plasmastrahl erzeugt, der eine sehr hohe Energiedichte aufweist. Dieser Plasmalichtbogen schmilzt die Werkstoffoberfläche, die mit Schutzgas umspült wird - örtlich begrenzt - sehr rasch auf. Der Energieeintrag und die Zufuhr des Schweißzusatzwerkstoffes in Pulverform oder Drahtform sind separat. Dadurch ergeben sich eine Vielzahl von Möglichkeiten. Die Wärmeinbringung in das Werkstück und die Aufmischung mit dem Grundmaterial werden gezielt beeinflusst.

Vorteile des Verfahrens:

- Geringe Aufmischung mit dem Grundwerkstoff
- Einfach herzustellender Zusatzwerkstoff - Mischung des Pulver, entsprechend der Anforderung
- Kleine Wärmeeinflusszone
- große Auftragsrate
- echte metallurgische Verbindung zwischen Grund- und Zusatzwerkstoff
- Reproduzierbarkeit – Ergebnis durch hohen Automatisierungsgrad
- Auftrag von harten, verschleißfesten und/oder korrosionsbeständigen Schichten

Vorteile der Plasmaschweißanlage:

- Einfache und komfortable Bedienung
- separate Wasserkühlung
- Digitale Steuerung am externen Bedienpult
- Stromstärke bis 300 A
- Plasmapulverschweißen und Elektrodenschweißen

Technische Parameter

Spannungsversorgung:	3x400 V / 50-60 Hz		
Schutzklasse:	IP 23 S		
Absicherung:	35 A		
Leerlaufspannung:	72 V		
Maximaler Schweißstrom:	300 A		
Einschaltdauer 40%/ED	Plasma:	300 A	Elektrode: 300 A
100%/ED		200 A	200 A
Einstellbereich Plasma / Elektrode:	20-300 A		
Pilotstrom:	10/5 A		
Ausstattung:	mit Umschalter auf Elektrodenschalter		
Gewicht:	119 kg (ohne Wasserkühler u. Pulverförderer)		
Abmessung (LxBxH):	950x485x840 mm (ohne Wasserkühler u. Pulverförderer)		
Kühlung:	separater Kühlwasserrückkühler		
Pulverzufuhr:	separater Pulverförderer		